
低温ポリシリコン TFT の生産性と品質を飛躍的に改善する 局所レーザーアニール技術について SID で講演

向夏の候、皆様におかれましては、ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

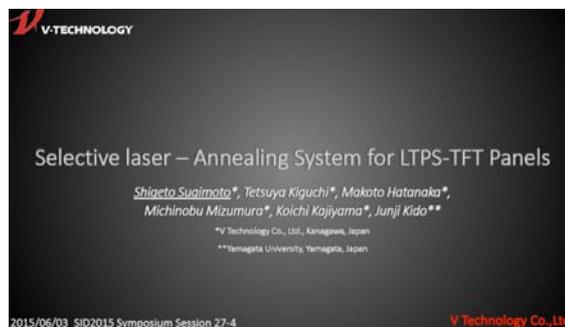
5月31日～6月5日に米国カリフォルニア州サンノゼで開催されたディスプレイに関する世界最大規模の国際学会「SID(Society for Information Display)」のシンポジウムに当社代表取締役社長の杉本重人が登壇し、今最も注目を集める「局所レーザーアニール技術」の講演をいたしました。当日は大勢の方のご来場と、数多くの反響を頂戴いたしました。此処に改めて御礼申し上げます。

本技術は、従来よりも大きなマザーガラスに対応可能なアニール技術として「独立行政法人科学技術振興機構(JST)の産学共同実用化開発事業(NexTEP)の支援のもと開発が進められています。

ガラス上の必要な箇所のみを局所的にアニールするという全く新しいコンセプトを採用しており、独自のレーザー加工用光学系と加工位置をリアルタイムで補正する技術により、生産性と質の高いアニール処理の実現を目指しております。



(写真)講演の様子



講演資料表紙

今後も皆様のご期待に沿えますよう、ディスプレイの進化を支える技術開発に邁進するとともに、大いなる志と溢れる情熱で、世界最高のイノベーションを創造し社会に貢献していく所存です。引き続き一層のご理解とご支援を賜りますよう宜しくお願い申し上げます。